

熱ナノインプリント装置



装置外観

【主な仕様】

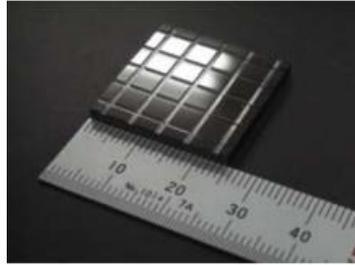
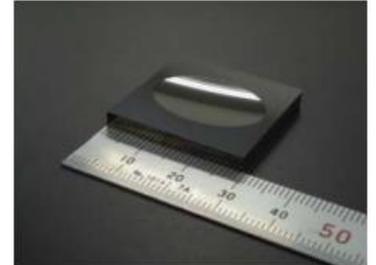
- ・加熱温度: 最大700°C
- ・加圧荷重: 最大15kN
- ・加圧範囲: 50mm × 50mm
- ・雰囲気: 大気, 真空、N₂ガス
- ・サンプリングデータ: 温度, 荷重, 経過時間, ストローク
- ・冷却方式: 炉冷, 空冷(配管通気), 水冷(配管通水)

機種名

オリジン電気製 Rerina-T50
2007年1月導入

用途

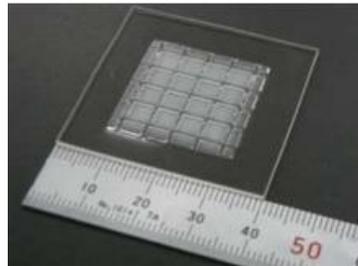
ガラス, 樹脂の熱インプリント
ホットエンボス

SiC製ブロックパターン
モールドSiC製トーリックレンズ
モールド

転写



転写

テンパックス製キャップ
ウェハ

BK7製トーリックレンズ

成型事例

料金等

機器使用: 1,500 円/時
操作法説明: 3,900 円(1時間)※

研究員による支援

3,900 円 / 時

※内容によっては長くなる場合があります。ご利用申し込みは実施日当日まで可能です。